

[HfO₂/SiO₂高反射膜的缺陷及其激光损伤](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)

高功率激光与光学

HfO₂/SiO₂高反射膜的缺陷及其激光损伤

[胡建平](#) [陈梅](#) [付雄鹰](#) [柴林](#)

(成都精密光学工程研究中心, 四川成都, 610041)

摘要: 用原子力、Normaski和扫描电子显微镜等分析仪器, 对高损伤阈值薄膜常采用的HfO₂光损伤所形成的孔洞, 与镀制过程中形成的孔洞形貌相似, 激光再损伤能力也相似。低能量密度的激光把节瘤缺陷变为孔洞缺陷是激光预处理提高薄膜损伤阈值的原因之一。

关键词: [HfO₂/SiO₂高反射薄膜](#) [表面缺陷](#) [激光损伤](#)

收稿日期

修回日期

通讯作者

DOI

分类号